## Si<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>価電子帯端オフセットの第一原理計算 First-principles calculation for valence band offset of Si<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>

First-principles calculation for valence band offset of  $Si_{1-x}Sn_x$ 

<sup>1</sup>名大院工, <sup>2</sup>名大高等研究院 <sup>3</sup>名大未来研, <sup>4</sup> JST さきがけ ○長江祐樹 <sup>1</sup>, 黒澤昌志 <sup>1,2,3,4</sup>, 洗平昌晃 <sup>1,2,3</sup>, 中塚理 <sup>1</sup>, 白石賢二 <sup>1,3</sup>, 財満鎭明 <sup>1,3</sup> <sup>1</sup>Grad. Sch. Eng., Nagoya Univ., <sup>2</sup>Inst. Adv. Res., Nagoya Univ., <sup>3</sup>IMaSS, Nagoya Univ., <sup>4</sup>PRESTO, JST ○Y. Nagae <sup>1</sup>, M. Kurosawa <sup>1,2,3,4</sup>, M. Araidai <sup>1,2,3</sup>, O. Nakatsuka <sup>1</sup>, K. Shiraishi <sup>1,3</sup>, and S. Zaima <sup>1,3</sup> E-mail: ynagae@alice.xtal.nagoya-u.ac.jp

[はじめに] 波長  $1.5 \, \mu m$  の光通信帯域に適合する光学材料として  $Si_{1-x}Sn_x$  直接遷移型半導体の創生に注目が寄せられている。しかし、Si に対する Sn 原子の低い熱平衡固溶限(約 0.1%)から、その作製、評価には困難が残されている。近年、我々は非熱平衡下で 30%に達する超高 Sn 組成多結晶  $Si_{1-x}Sn_x$  の作製を実現し、またその光学特性なども報告してきた[1]。本研究では、発光素子構造等の設計に不可欠である  $Si_{1-x}Sn_x$  のエネルギーバンド構造の解明を目的に、第一原理計算による  $Si_{1-x}Sn_x$  価電子帯端オフセット(VBO)の理論予測および Sn 組成に対する VBO の挙動の物理的要因の理解を目指した。[計算手法とおよび計算モデル] 密度汎関数法(density functional theory: DFT)第一原理計算パッケージである Vienna ab initio simulation package(VASP)[2, 3]を用いて、 $Si_{1-x}Sn_x$  の 8 原子ダイアモンド単位胞に対して電子状態計算を行った。交換相関項には改良型 Vienna Becke-Johnson 交換ポテンシャル、電子・イオン間相互作用には Viena projector augmented wave ポテンシャルを用いた。各組成における物性値を、ユニークな原子配置ごとの物性値の形成確率重み付け平均をとる手法(Viena Hakoniwa method [4])で計算した。

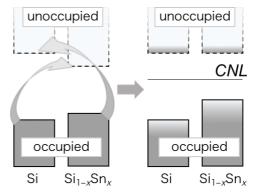
[計算結果] はじめに半導体接合界面における電子 軌道混成に基づいて、各原子配置の  $Si_{1-x}Sn_x$  の電荷 中性準位 (charge neutrality level: CNL) を計算した。 占有・非占有軌道間の電子移動後の平衡 Fermi 準位  $\phi(CNL)$ が CNL に等しいと置けば次式で表せる[5]。

$$\phi(\text{CNL}) = \text{VBM} + \frac{E_{\text{g}}D_{\text{VB}}}{D_{\text{VB}} + D_{\text{CB}}}$$

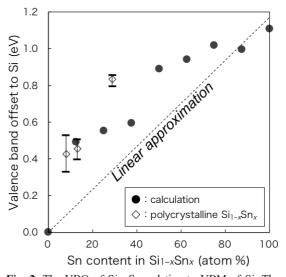
ここで、VBM は価電子帯端準位、 $D_{VB}$  および  $D_{CB}$ は、それぞれ価電子帯端および伝導帯端の状態密度、 Eg はバンドギャップを表している。異なる組成の Si<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>間において DFT 計算で得た VBM の差を単 純に VBO として比較、評価できない。そのため、 CNL を基準とした VBM を決定し、Si<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>間の VBO を評価した (Fig. 1)。Si に対する Si<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub>の VBO を Fig. 2 に示す。図中の●および◇は、それぞれ理論 計算および多結晶 Si<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> に対する実験値(硬 X 線 光電子分光法で得られた価電子帯スペクトルから 算出した値) [6]である。破線は、Si と α-Sn の報告 値[7]をもとにVBOがSn組成で線形変化するものと して引いた近似曲線である。実験値はこの線形近似 曲線に比べ上側へずれる傾向にあった。この実験結 果を比較的再現する計算結果が得られたことがよ く分かる。当日の講演までには、VBO の Sn 組成依 存性がなぜ非線形性を示すのか、物理的起源を明ら かにし、詳細な議論も合わせて報告したい。

[謝辞] 本研究の一部は、JSPS 科研費・基盤研究(S) (No. 26220605) および JST さきがけの研究助成により実施されました。

[参考文献] [1] M. Kurosawa et al., Appl. Phys. Lett. 106, 171908 (2015). [2] G. Kresse et al., Phys. Rev. B 54, 11169 (1996). [3] B. Adolph et al., Phys. Rev. B 63, 125108 (2001). [4] E. Kamiyama et al., Mater. Sci. Semicond. Proc. 43, 209 (2016). [5] M. Cardona et al., Phys. Rev. B 35, 6182 (1987). [6] M. Kurosawa et al., "Silicon-tin semiconductors for near-infrared optoelectronic device applications," International Symposium on EcoTopia Science 2015, Nagoya, 28-3-9 (2015). [7] J. Menéndez et al., Appl. Phys. Lett. 85, 1175 (2004).



**Fig. 1.** Schematic view of the calculation of CNL by the correlation between occupied and unoccupied states in  $Si_{1-x}Sn_x$ .



**Fig. 2**. The VBO of  $Si_{1-x}Sn_x$  relative to VBM of Si. The calculated results are plotted as circle and experimental results are plotted as diamonds (polycrystalline). Broken line corresponds to the result of the linear approximation for VBO between values of  $\alpha$ -Sn and Si from Ref. 7.